

米国・NY州に半導体製造プロセスの海外開発拠点「ATCA」を開設

世界トップを誇るウエハー洗浄技術の開発を加速

株式会社SCREENホールディングスはこのたび、半導体製造装置事業における製品競争力の強化を目指し、米国・ニューヨーク州に研究開発拠点として「SCREEN Advanced Technology Center of America, LLC（以下、ATCA）」を設立したことをお知らせします。



ATCAが入居する

Albany NanoTech Complex

印刷用データ（解像度300dpi）は、下記URLよりダウンロード可能

www.screen.co.jp/about/nr-photo_2025

洗浄工程が30%以上を占める半導体製造において、微細化ニーズの高まりや半導体パッケージの進展に伴い、成膜・回路形成前の洗浄やCMP後の洗浄、選択的ウエットエッチング、後工程洗浄などを中心に洗浄工程数は増加しており、高度な洗浄の重要性が一段と高まっています。

このような動向を背景に、製品の性能と対応力および環境性能を高め、高度化する業界のニーズに応えるため、米国・ニューヨーク州で最先端の半導体研究施設を運営するNY Creates*（ニューヨーク・クリエイツ、以下、NYCR）と提携し、北米で最も進んだ非営利半導体関連研究開発センターである同社の施設「Albany NanoTech Complex」内に、研究開発拠点「ATCA」を設立しました。ATCAは929平方メートルのクリーンルームと462平方メートルのオフィススペースから成ります。

今後、NYCRが所有するクリーンルーム内に当社装置を設置し、最先端デバイスの特性評価を行うことで、次世代プロセスの開発を加速するとともに、顧客、コンソーシアム、大学・研究機関、サプライヤーおよび同施設に入居する世界的に有名な他企業など、幅広いステークホルダーと協業する機会拡充を図ります。また、要素技術の研究開発拠点である洛西事業所や、彦根事業所内にある半導体製造装置の開発拠点「プロセス技術センター」と連携します。これにより、当社がトップシェアを誇る洗浄領域だけでなく、熱処理、アドバンスドパッケージなどの先端技術領域における要素技術・装置開発に要する期間を短縮し、製品競争力の強化と付加価値向上を見込んでいます。

本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREENホールディングス

経営戦略本部 コーポレートコミュニケーション室 広報部 Tel: 075-414-7131 nr-info@screen.co.jp

当社は、今後も企業価値向上に向けた取り組みを続けることで、半導体製造装置のさらなるシェア拡大を目指すとともに、収益性向上と競争力強化を図っていきます。また、環境性能の高い装置を半導体業界へ提供し、サステナブルな社会の実現に貢献していきます。

■ATCA（会社）の概要

社 名	SCREEN Advanced Technology Center of America, LLC（ATCA）
所 在 地	201 Fuller Road, Suite 306, Albany, NY 12203, U.S.A.
代 表 者	Ian Brown, President
設 立	2025年12月1日

■ATCA（設備）の概要

賃 賃 面 積	クリーンルーム：929平方メートル オフィス：462平方メートル
主 な 用 途	半導体製造プロセスの研究・装置開発
設備投資額	総額120億円規模（2027年3月期まで、リソースを含む費用は別途計上）

＊ NY Creates（New York Center for Research, Economic Advancement, Technology, Engineering and Sciences Corp.）

過去の関連ニュースリリース（2025年2月14日発表）

半導体製造装置の開発強化に向けて、海外に新拠点を設置

<https://www.screen.co.jp/news/NR250214-3>

本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREENホールディングス

経営戦略本部 コーポレートコミュニケーション室 広報部 Tel: 075-414-7131 nr-info@screen.co.jp